

Id Apogée	Libelle	NEL	PEL	NbH CM	NbH TD	NbH TP	ECTS	Code CNU	Session 1	Coeff	Durée	Session 2	Coeff	Durée
129BC13	Instrumentation et procédés de fabrication	BCC	AN				8							
129UD51	Mesure et instrumentation avancée	UE	S9	5	10	8	3	28						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	60%	2H	Ecrit E2	60%	2h
	Travaux pratiques	EPR							TP P1	40%	2H	Report de note session 1		
129UD35	Microscopies	UE	S9	20	4		3	28						
	Electronique : Contrôle continu	EPR							CC1 C1	50%	2H	Ecrit E2	100%	2h
	Champ proche : Contrôle continu	EPR							CC2 C2	50%	2H			
129UD34	Microtechnologies-Microsystèmes	UE	S9	12		6	2	28						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	60%	2H	Ecrit E2	60%	2h
	Travaux pratiques	EPR							TP P1	40%	2H	Report de note session 1		
129BC11	Nanophysique et modélisation	BCC	AN				11							
129UD39	Modélisation numérique des Nanomatériaux (ab-initio, DFT,)	UE	S9	10		20	3	28						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	33,33%	2H	Ecrit E2	33,33%	2h
	Travaux Pratiques	EPR							TP P1	33,33%	2H	Report de note session 1		
	Travaux Pratiques	EPR							TP P2	33,33%	2H			
129UD43	Nanophysique et nanomagnétisme	UE	S9	20	20		4	28						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100%	2h
129UD31	Physique du solide et des surfaces	UE	S9	10	10		2	27						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100%	2h
129UD45	Transport électronique et théorie moderne de la polarisation	UE	S9	10	10		2	28						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100%	2h
129BC15	Pratiques socio-professionnelles et stage	BCC	AN				27							
129UL11	Anglais	UE	S9		20		4	11NS						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H
120UP11	Stage	UE	S0				23							
	Soutenance	EPR							Soutenance	100%		Pas de seconde session		
129BC12	Techniques innovantes en optique et diffraction	BCC	AN				11							
129UD50	Capteurs et mesures holographiques	UE	S9	20		8	4	28						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	66,67%	2H	Ecrit E2	66,67%	2h
	Travaux pratiques	EPR							TP P1	33,33%	2H	Report de note session 1		
129UD33	Techniques avancées de diffraction et diffusion	UE	S9	10	10	8	3	28						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	60%	2H	Ecrit E2	60%	2h
	Travaux Pratiques	EPR							TP P2	40%	2H	Report de note session 1		
129UD40	Nanophotonique	UE	S9	20			2	28						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	66,67%	2H	Ecrit E2	66,67%	2h
	Oral	EPR							Oral O1	33,33%	30min	Report de note session 1		
129UD36	Physique ultrarapide	UE	S9	10	5		2	28						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100%	2h
129BC14	UE optionnelle (1/2)	BCC	AN				3							
129UD32	Electronique plastique	UE	S9	24			3	29						
	Contrôle terminal	EPR							Ecrit E1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H
129UD44	Plasmonique et applications	UE	S9	10		10	3	28						
	Contrôle continu	EPR							CC1 C1	100%	2H	Ecrit E2	100,00%	2H

**La formation est structurée en blocs de connaissances et de compétences pour l'année.**

Afin d'obtenir le M1, l'étudiant devra obtenir :

- Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l'année

Les enseignements se compensent des blocs

Les blocs se compensent dans l'année